

УДК 669.26

© 1991

**ПРИРОДА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МИНИМУМОВ
ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ
В АНТИФЕРРОМАГНИТНЫХ СПЛАВАХ ХРОМА
С НЕМАГНИТНЫМИ ПРИМЕСЯМИ**

В. Ю. Галкин

Исследовано влияние легирования марганцем и ванадием на поведение электросопротивления антиферромагнитного сплава Cr—1.3 ат.% Si. Построена магнитная фазовая диаграмма исследуемой серии сплавов. Тип антиферромагнитной фазы ниже точки Нееля, а также граница перехода между соизмеримой и несоизмеримой фазами определялись по величине магнитной составляющей теплового расширения. Показано, что появление низкотемпературных минимумов электросопротивления в исследуемых сплавах можно объяснить резонансным рассеянием на примесных уровнях. Обнаружено существенное различие в механизмах примесного резонансного рассеяния в сплавах с соизмеримой и несоизмеримой структурами. На основании результатов, полученных для тройных сплавов Cr—1.3 ат.% Si, легированных Mn и V, в рамках модели примесного резонансного рассеяния дано объяснение возникновения низкотемпературных аномалий электросопротивления в бинарных сплавах Cr—Si.

Хром и сплавы на его основе являются зонными антиферромагнетиками с магнитной структурой, описываемой линейно-поляризованной волной спиновой плотности (ВСП). Исследованию физических свойств этих объектов посвящено большое количество теоретических и экспериментальных работ (см., например, список литературы в обзорах [1, 2]).

Одной из наиболее интересных особенностей кинетических свойств антиферромагнитных (АФ) сплавов на основе Cr является наличие в некоторых из них (Cr—Fe^[3, 4], Cr—Co^[5], Cr—Ni^[6], Cr—Si^[7] и Cr—Ge^[8]) низкотемпературных минимумов и других аномалий электросопротивления. Хорошо известно, что такие аномалии, возникающие в парамагнитных сплавах с магнитной примесью, хорошо описываются в рамках модели Кондо. Магнитное упорядочение препятствует рассеянию с поворотом спина. Тем не менее, принимая во внимание, что в АФ сплавах Cr—Fe и Cr—Co атомы Fe и Co обладают локализованными магнитными моментами, Катано и Мори^[4, 5] предприняли попытку объяснить появление низкотемпературных минимумов электросопротивления в этих сплавах в рамках модели Кондо. Однако модель Кондо не в состоянии объяснить наличие аналогичных минимумов электросопротивления в АФ сплавах Cr—Si, Cr—Ge и Cr—Ni, в которых примесь не обладает локализованным магнитным моментом. Кроме того, эта модель противоречит ряду экспериментальных результатов, полученных для АФ сплавов Cr—Fe и Cr—Co^[9].

Появление низкотемпературных минимумов электросопротивления в АФ сплавах на основе хрома может быть также связано с механизмом примесного резонансного рассеяния. Наличие этого механизма рассеяния в АФ сплавах Cr как с магнитными, так и немагнитными примесями было теоретически показано в работах^[10, 11]. Согласно модели примесного резонансного рассеяния, внутри энергетической щели, возникающей на части поверхности Ферми в энергетическом спектре сплавов Cr ниже температуры Нееля T_N , появляются примесные уровни. В том случае, когда

химический потенциал сплава μ приближается к примесному уровню, с энергией E_{imp} , рассеяние электронов проводимости имеет резонансный характер. Вклад этого типа рассеяния в полное электросопротивление в области температур, не слишком близких к точке Нееля, можно представить в следующем виде:

$$\rho_{\text{res}}(T) = \frac{b}{1 + a^2 + \frac{\pi^2 T^2}{3\gamma^2}}, \quad (1)$$

где

$$b = \frac{2m^* n_{\text{res}}}{n_e e^2 \pi N_r(0)}, \quad a = \frac{E_{\text{imp}} - \mu}{\gamma},$$

n_e — концентрация электронов в резервуаре, n_{res} — концентрация резонансных примесей, γ — ширина резонансного уровня, $N_r(0)$ — средняя плотность состояний на уровне Ферми для резервуара, m^* и e — эффективная масса и заряд электрона. Для анализа экспериментальных данных b можно считать феноменологическим параметром, пропорциональным концентрации резонансных примесей.

В области низких температур $T \ll \gamma$ выражение (1) можно представить в виде

$$\rho_{\text{res}}(T) = \rho_{\text{res}1}(T) + \rho_{\text{res}2}(T), \quad (2)$$

где

$$\rho_{\text{res}1}(T) = \frac{b}{1 + a^2(T)}, \quad \rho_{\text{res}2}(T) = -\frac{\pi^2 T^2 b}{3\gamma^2 (1 + a^2(T))^2}.$$

При условии $T \ll \gamma$ вклад $\rho_{\text{res}2}(T)$ в первом приближении будет изменяться по закону $-T^2$, так как температурный вклад от члена $a^2(T)$ будет мал в меру высших по T слагаемых.

Легко видеть, что в сплавах на основе Cr с высокими значениями n_{res} примесное резонансное рассеяние должно приводить к немонотонной зависимости остаточного электросопротивления (реально — электросопротивления при 4.2 К — $\rho_{4.2}$) как функции параметра ($\mu - E_{\text{imp}}$). При выполнении условия резонанса ($\mu \rightarrow E_{\text{imp}}$) $\rho_{4.2}$ должно резко возрасти.

Изменение этого параметра можно осуществить, например, путем легирования сплавов на основе Cr марганцем или ванадием. Хорошо известно, что в первом случае легирование приводит к повышению химического потенциала, а во втором — к его понижению, причем в обоих случаях справедлива модель жесткой зоны [1].

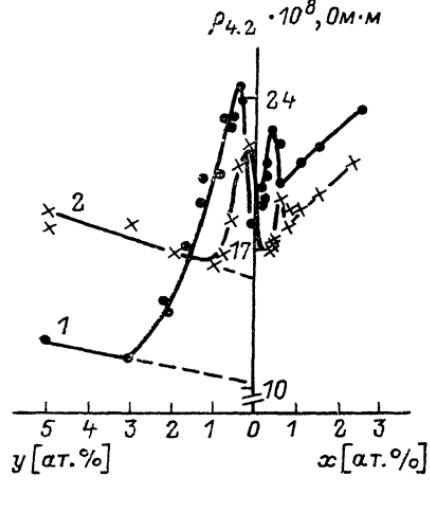
Исследование влияния легирования марганцем и ванадием на электросопротивление при 4.2 К АФ сплавов Cr—2.7 ат. % Fe и Cr—1.3 ат. % Si показало, что для обеих серий сплавов ((Cr_{1-x}Mn_x)—2.7 ат. % Fe, (Cr_{1-y}V_y)—2.7 ат. % Fe и (Cr_{1-x}Mn_x)—1.3 ат. % Si, (Cr_{1-y}V_y)—1.3 ат. % Si) на кривых $\rho_{4.2}(x, y)$ (рис. 1) наблюдаются два резких пика [12]. В соответствии с выражением (2) был сделан вывод, что наличие этих пиков обусловлено примесным резонансным рассеянием и наблюдаемое резкое возрастание $\rho_{4.2}$ при соответствующих концентрациях Mn и V (x_{res} и y_{res}) связано с прохождением химического потенциала через примесные уровни E_{imp}^+ и E_{imp}^- , отщепленные соответственно от нижнего и верхнего края щели ВСП.

В рассматриваемых сериях сплавов $\rho_{4.2}(x, y)$ можно представить в виде $\rho_{4.2}(x, y) = \rho_{4.2 \text{ res}}(x, y) + \rho_{4.2 \text{ pot}}(x, y)$, где $\rho_{4.2 \text{ res}}$ и $\rho_{4.2 \text{ pot}}$ — вклады от резонансного и потенциального примесного рассеяния. При некоторых значениях концентрации V сплавы (Cr_{1-y}V_y)—2.7 ат. % Fe и (Cr_{1-y}V_y)—1.3 ат. % Si становятся парамагнитными. В этом случае $\rho_{4.2 \text{ res}}(y) = 0$. Экстраполируя $\rho_{4.2}(y)$ из парамагнитной в антиферромагнитную область концентраций V (штриховые линии на рис. 1), можно оценить $\rho_{4.2 \text{ pot}}(y)$ и, таким образом, разделить потенциальный и резонансный вклады в $\rho_{4.2}$. Из проведенных оценок следует, что при $y = y_{\text{res}}$ величина $\rho_{4.2 \text{ res}}$ составляет

ляет ~60 % от $\rho_{4.2}$ в сплаве $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ —2.7 ат.-% Fe и ~40 % в сплаве $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ —1.3 ат.-% Si.

В работах [9, 13] были проанализированы температурные зависимости электросопротивления сплавов Cr—2.7 ат.-% Fe, легированных Mn и V, и показано, что достаточно сложное изменение характера поведения $\rho(T)$ при изменении концентрации легирующих элементов, а именно появление и исчезновение минимумов, максимумов и других низкотемпературных аномалий электросопротивления, можно объяснить исходя из модели примесного резонансного рассеяния. Кроме того, было показано, что в рамках этой модели можно объяснить наличие низкотемпературных аномалий электросопротивления в бинарных сплавах Cr—Fe.

Поскольку вклад примесного резонансного рассеяния в полное электросопротивление как в АФ сплавах Cr—Fe, так и в АФ сплавах Cr—Si



велик и сильно зависит от положения μ относительно E_{imp} , есть основания полагать, что появление в сплавах Cr—Si низкотемпературных минимумов электросопротивления [7], так же как и в сплавах Cr—Fe, связано с примесным резонансным рассеянием.

Для проверки этой гипотезы были проведены измерения температурных

Рис. 1. Зависимость электросопротивления при 4.2 К серий сплавов $(\text{Cr}_{1-x}\text{Mn}_x)$ —2.7 ат.-% Fe, $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ —2.7 ат.-% Fe (кривая 1) и серий сплавов $(\text{Cr}_{1-x}\text{Mn}_x)$ —1.3 ат.-% Si и $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ —1.3 ат.-% Si (кривая 2) как функции концентраций Mn и V.

зависимостей электросопротивления сплавов Cr—1.3 ат.-% Si, легированных Mn и V, и проанализировано их поведение с учетом вклада примесного резонансного рассеяния.

Недавно было теоретически показано [14], что процессы примесного резонансного рассеяния в сплавах на основе Cr с различной АФ структурой могут существенно отличаться. Для выявления этих различий нами была построена магнитная фазовая диаграмма исследуемой серии сплавов на основе Cr—1.3 ат.-% Si и проанализировано влияние примесного резонансного рассеяния на характер температурных зависимостей электросопротивления в сплавах с соизмеримой и несоизмеримой магнитными фазами. Поскольку магнитная составляющая теплового расширения в сплавах на основе Cr чрезвычайно чувствительна к типу АФ фазы, для построения магнитной фазовой диаграммы были проведены измерения теплового расширения и выделена магнитная составляющая.

1. Приготовление образцов и методика эксперимента

Образцы для измерения теплового расширения и электросопротивления вырезались из тех же слитков сплавов, исследованных в работе [12]. Химический состав сплавов определялся методом индукционно-связанной плазмы и представлен в таблице. Образцы для измерения электросопротивления имели размеры $0.7 \times 0.7 \times 15$ мм. Контакты подваривались электроискровым методом. Измерения температурных зависимостей электросопротивления проводились в интервале температур 4.2—370 К в стандартном температурном приборе по четырехконтактной схеме.

Измерения теплового расширения в интервале температур 80—400 К проводились на дилатометре ДЛ 75/30 (Линсайд, ФРГ), а в интервале

	№									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
z , ат. %	1.31	1.31	1.36	1.31	1.33	1.40	1.42	1.31	1.29	1.32
x , ат. %	0	0.17	0.30	0.47	0.61	0.73	1.13	1.59	2.32	3.87

Продолжение

	№											
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
z , ат. %	1.28	1.32	1.31	1.34	1.29	1.32	1.31	1.33	1.36	1.38	1.35	1.34
y , ат. %	0.04	0.09	0.15	0.23	0.31	0.42	0.59	0.81	0.99	1.53	1.98	3.03

температуру 293—1100 К — на дилатометре ДЛ 1500 (Шинку Рику, Япония). В обоих приборах измерения проводились на одних и тех же

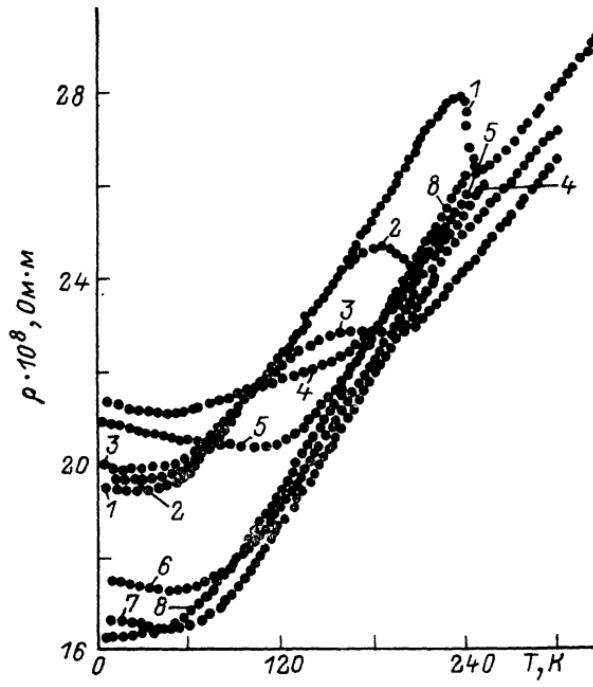


Рис. 2. Зависимость ρ (T) сплавов ($\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y$)—1.3 ат. % Si с концентрацией V: 0 (1), 0.04 (2), 0.09 (3), 0.23 (4), 0.42 (5), 0.59 (6), 0.81 (7), 0.99 ат. % (8).

образцах в форме параллелепипедов с размером $3 \times 3 \times 20$ мм. Полученные данные сстыковались, и для каждого образца строилась единая зависимость $\Delta l/l$ (T) для всего интервала температур 80—1100 К.

Оба дилатометра работают по принципу дифференциального трансформатора. Разрешение дилатометров менее 0.1 мкм.

При обработке экспериментальных данных на компьютере учитывались поправки на тепловое расширение кварца. С помощью компьютера также проводилось выделение магнитной составляющей теплового расширения.

2. Результаты измерений и их обсуждение

На рис. 2 представлены температурные зависимости электросопротивления исследуемых сплавов в интервале температур 4.2–350 К, а на рис. 3 — в интервале температур 4.2–70 К.

Как видно из рис. 2, 3, в исследуемых сплавах, так же как и в сплавах Cr—2.7 ат.-% Fe, легированных V (см. рис. 4, взятый из [9]), наблюдаются низкотемпературные минимумы электросопротивления. Однако в отличие от сплавов на основе Cr—2.7 ат.-% Fe эти минимумы наблюдаются в широком интервале концентраций V и Mn.

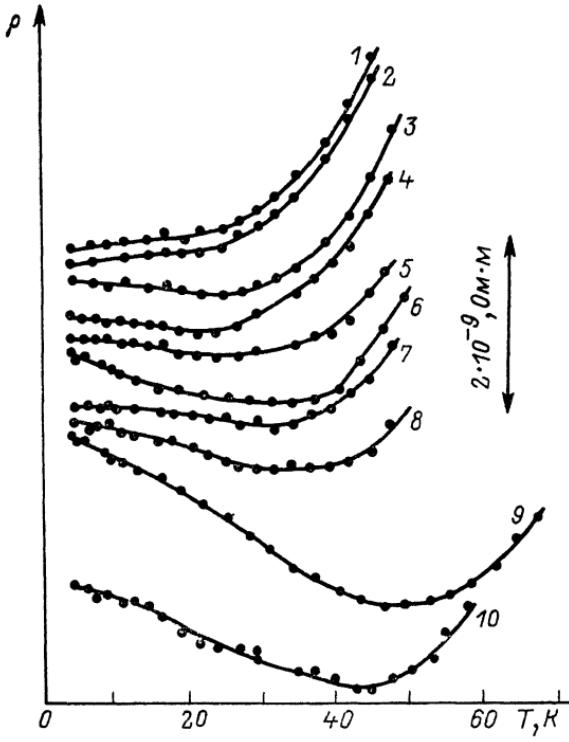


Рис. 3. Низкотемпературная зависимость $\rho(T)$ сплавов $(\text{Cr}_{1-x}\text{Mn}_x)-1.3$ ат.-% Si с концентрацией Mn: 0.73 (1), 0.61 (2), 0.47 (3), 0.30 (4), 0.17 (5), 0 ат.-% (6) и сплавов $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)-1.3$ ат.-% Si с концентрацией V: 0.04 (7), 0.09 (8), 0.23 (9), 0.31 ат.-% (10).

Поскольку теория [14] предсказывает различный характер примесного резонансного рассеяния в сплавах Cr с различным типом АФ структуры, для анализа поведения $\rho(T)$ необходимо знать магнитную фазовую диаграмму исследуемых сплавов. При построении магнитной фазовой диаграммы температура Нееля определялась по соответствующим аномалиям электросопротивления и теплового расширения. Известно, что величина магнитной составляющей теплового расширения в сплавах с соизмеримой структурой выше, чем в сплавах с несоизмеримой структурой [15, 16]. Поэтому температуру фазового перехода между соизмеримой и несоизмеримой фазами, так же как и тип структуры ниже T_N , можно определить из измерений теплового расширения.

Величина магнитной составляющей теплового расширения исследуемых сплавов $\Delta l_{\text{маг}}/l(T)$ определялась следующим образом:

$$\Delta l_{\text{маг}}/l(T) = \Delta l/l(T) - \Delta l_{\text{пар}}/l(T),$$

где $\Delta l/l(T)$ — температурные зависимости теплового расширения исследуемых сплавов, $\Delta l_{\text{пар}}/l(T)$ — температурная зависимость теплового расширения сплава $(\text{Cr}_{0.95}\text{V}_{0.05})-1.3$ ат.-% Si. Добавление 5 ат.-% V приводит к полному исчезновению антиферромагнетизма в сплаве Cr—1.3 ат.-%

Si (при этом параметр решетки изменяется на долю процента), поэтому этот сплав идеально подходит для выделения магнитной части теплового расширения.

Магнитная фазовая диаграмма сплавов Cr—1.3 ат.-% Si, легированных Mn и V, представлена на рис. 5. Поскольку измерения теплового расширения проводились только при $T > 80$ К, граница фазового перехода между соизмеримой и несоизмеримой фазами была проэкстраполирована в область низких температур.

Согласно теоретическим расчетам [14], в энергетической щели сплавов Cr с несоизмеримой структурой может возникнуть целый набор примесных

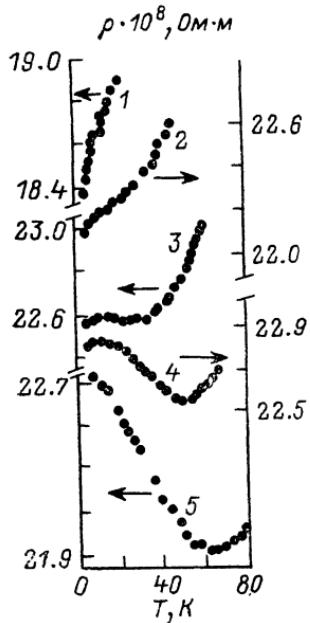


Рис. 4. Зависимость ρ (T) сплавов $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)-2.7$ ат.-% Fe с концентрацией V: 0 (1), 0.2 (2), 0.3 (3), 0.45 (4), 0.5 ат.-% (5).

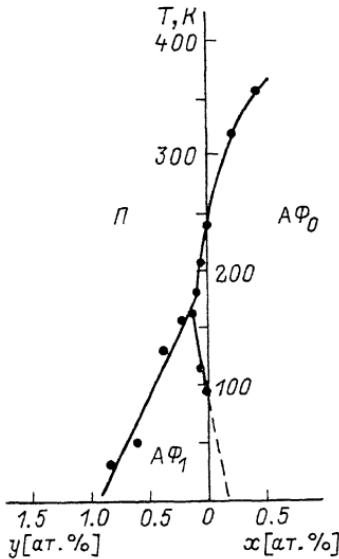


Рис. 5. Магнитная фазовая диаграмма сплавов $(\text{Cr}_{1-x}\text{Mn}_x)-1.3$ ат.-% Si, $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)-1.3$ ат.-% Si.

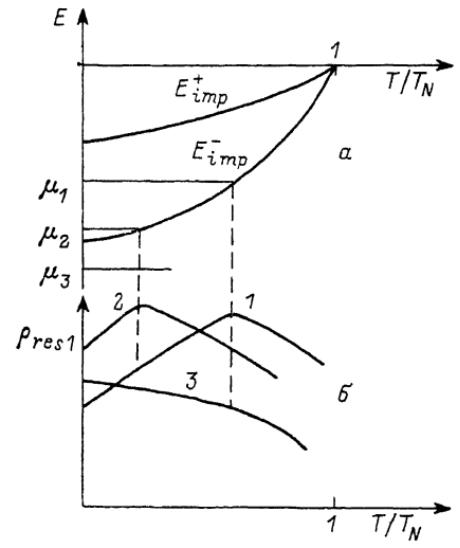
П — парамагнитная фаза, $A\Phi_1$ и $A\Phi_0$ — несоизмеримая и соизмеримая антиферромагнитные фазы.

резонансных уровней в достаточно широком интервале энергий. Поскольку, согласно фазовой диаграмме, все сплавы $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)-1.3$ ат.-% Si в области низких температур имеют несоизмеримую структуру, можно предположить, что пик на кривой $\rho_{4.2}(y)$ (кривая 2 на рис. 1) связан не с резонансным рассеянием на отдельном примесном уровне, как в случае сплава $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)-2.7$ ат.-% Fe [10], а с рассеянием на сгустке примесных уровней. Исходя из формы кривой $\rho_{4.2}(y)$, можно предположить, что распределение этих уровней внутри энергетической щели не является равномерным и положение центра сгустка уровней совпадает с μ сплава $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)-1.3$ ат.-% Si ($y = y_{\text{res}} \approx 0.2$ ат.-%).

Для обсуждения причин появления низкотемпературных аномалий электросопротивления в исследуемых сплавах рассмотрим вклад примесного резонансного рассеяния в полное электросопротивление. Сначала рассмотрим более простой вариант сплава с двумя примесными уровнями, как в случае сплава Cr—2.7 ат.-% Fe. Поскольку величина энергетической щели 2Δ , возникающая в энергетическом спектре АФ сплавов на основе Cr, имеет температурную зависимость, близкую к функции БКШ [2], а энергии примесных резонансных уровней, имеющих начало отсчета в середине энергетической щели, пропорциональны Δ [11], зависимости $E_{\text{imp}}^+(T)$ и $E_{\text{imp}}^-(T)$ должны иметь тот же вид, что и $\Delta(T)$ (рис. 6, a). На этом рисунке ось абсцисс совпадает с серединой энергетической щели.

Зная качественно зависимость $E_{\text{imp}}(T)$, можно определить вид температурных зависимостей первого члена в выражении (2) — $\rho_{\text{res } 1}(T)$. Ряд таких кривых для различного положения μ относительно E_{imp} представлен на рис. 6, б. В первом и втором случаях зависимости $\rho_{\text{res } 1}(T)$ аналогичны с той разницей, что в первом случае $T_{1\max}$ находится в области температур, где вклад фононного члена ($\rho_{\phi} \sim T^5$) достаточно велик, а во втором случае $T_{2\max}$ находится в области температур, где вклад ρ_{ϕ} практически отсутствует.

Второй член в уравнении (2) $\rho_{\text{res } 2}(T)$ в первом приближении не зависит от положения μ относительно E_{imp} и во всех случаях с ростом температуры дает отрицательный вклад ($\partial \rho_{\text{res } 2} / \partial T < 0$) в полное электросопротивление $\rho(T)$. Таким образом, в первом и втором случаях при $T < T_{\max}$ $\rho_{\text{res } 1}(T)$ и $\rho_{\text{res } 2}(T)$ дают противоположный вклад в $\rho(T)$;



при $T > T_{\max}$, а также в случае, когда $\mu < E_{\text{imp}0}$ (μ_3 на рис. 6, а) оба члена дают отрицательный вклад в $\rho(T)$. Для того чтобы установить, вклад какого члена является определяющим, рассмотрим экспериментальные зависимости $\rho(T)$ сплавов $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ — 2.7 ат. % Fe, у которых положение μ относительно $E_{\text{imp}0}$ соответствует первому и второму из рассматриваемых

Рис. 6. Температурные зависимости $E_{\text{imp}}^-(T)$, $E_{\text{imp}}^+(T)$ и $\mu_i(T)$ для сплавов на основе Cr с соизмеримой структурой с различным положением μ относительно $E_{\text{imp}0}$ (схематично) (а). Температурные зависимости $\rho_{\text{res } 1}(T)$ для сплавов с различным положением μ (б).

вариантов (μ_1 и μ_2 на рис. 6, а). Как следует из рис. 4, на кривых $\rho(T)$ сплавов $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ — 2.7 ат. % Fe с $y=0$ и 0.2 ат. %, которые представляют собой первый из рассматриваемых случаев (положение μ относительно $E_{\text{imp}0}$ можно определить из зависимости $\rho_{4.2}(y)$; рис. 1), ниже температуры 7—12 К наблюдается более резкое падение электросопротивления, а на кривых $\rho(T)$ сплавов с $y=0.3$ и 0.45 ат. %, которые можно отнести ко второму случаю, при $T < T_{\min}$ наблюдаются максимумы электросопротивления. Такое изменение характера поведения электросопротивления при изменении положения μ относительно $E_{\text{imp}0}$ свидетельствует, что вклад $\rho_{\text{res } 1}(T)$ в температурную зависимость $\rho(T)$ более весомый, чем вклад $\rho_{\text{res } 2}(T)$ ($|\partial \rho_{\text{res } 1} / \partial T| > |\partial \rho_{\text{res } 2} / \partial T|$).

Для того чтобы убедиться в том, что изменение $\rho_{\text{res } 1}$ в области низких температур достаточно велико для подавления $\rho_{\text{res } 2}(T)$, мы провели оценку зависимости $\rho_{\text{res } 1}(T)$ исходя из следующих соображений. Зная смещение μ при добавлении 1 ат. % V (~ 20 мэВ [10]), из зависимости $\rho_{4.2}(y)$ (кривая 1 на рис. 1) можно оценить изменение $\rho_{4.2}$ в сплавах $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ — 2.7 ат. % Fe при отклонении μ от $E_{\text{imp}0}$. Несмотря на то что при низких температурах (особенно в случае достаточно высоких значений $T_N \approx 250$ К) $E_{\text{imp}}^-(T)$ является медленно меняющейся функцией температуры, изменение $\rho_{\text{res } 1}(T)$ вследствие резонансной зависимости $\rho_{4.2}(\mu)$ должно быть достаточно сильным.

Теперь рассмотрим вклад резонансного рассеяния в $\rho(T)$ сплавов Cr с несоизмеримой структурой, к числу которых относятся сплавы $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ — 1.3 ат. % Si и $(\text{Cr}_{1-x}\text{Mn}_x)$ — 1.3 ат. % Si с $x \leq 0.2$ ат. % (рис. 5). Поскольку, согласно [14], в энергетической щели таких сплавов расположен целый густок резонансных уровней, можно ожидать, что одновременно будут

реализованы все три типа рассмотренных выше вкладов $\rho_{\text{res}}(T)$ в $\rho(T)$. Напомним, что в первом и втором случаях при $T < T_{\max}$ вклады $\rho_{\text{res}1}(T)$ и $\rho_{\text{res}2}(T)$ противоположны по знаку; при $T > T_{\max}$, а также при условии $\mu < E_{i\text{imp}0}$ знаки обоих вкладов совпадают. Поэтому вклад $\rho_{\text{res}}(T)$ в температурную зависимость $\rho(T)$ в последнем случае является наименее весомым. При повышении μ исследуемых сплавов, происходящем при понижении концентрации V, доля $\rho_{\text{res}}(T)$, дающая отрицательный вклад в полное электросопротивление, должна снижаться, а доля $\rho_{\text{res}}(T)$, дающая положительный вклад, должна возрастать. Однако, поскольку первый из этих вкладов является более весомым, условие образования низкотемпературных минимумов электросопротивления может выполняться в широкой области изменения μ .

Эти представления полностью подтверждаются экспериментальными данными — минимумы электросопротивления в сплавах Cr—1.3 ат.% Si, легированных Mn и V, наблюдаются в широкой области концентраций V и Mn. Более того, величина T_{\min} , так же как и глубина минимумов, монотонно понижается с понижением концентрации V (рис. 3).

Из зависимости $\rho_{4.2}(y)$ (рис. 1) следует, что в сплавах $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ —1.3 ат.% Si ($y > 0.2$ ат.%) основная часть примесных резонансных уровней располагается выше μ . Кроме того, T_N этих сплавов имеют низкие значения и зависимость $E_{i\text{imp}}(T)$ становится достаточно крутой даже в области низких температур. Поэтому отрицательный вклад $\rho_{\text{res}}(T)$ в $\rho(T)$ должен быть очень большим. Это положение также подтверждается экспериментом. Для всех сплавов с $y > 0.2$ ат.% ниже T_N наблюдается аномальный рост электросопротивления с понижением температуры.

Следует отметить, что в сплавах на основе Cr—1.3 ат.% Si не обнаружены низкотемпературные максимумы электросопротивления, аналогичные наблюдаемым на сплавах $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ —2.7 ат.% Fe. Как было показано выше, эта аномалия должна возникнуть в сплаве с $\mu \geq E_{i\text{imp}0}$ (μ_2 на рис. 6). По-видимому, в связи с тем что в сплавах на основе Cr—1.3 ат.% Si имеется целый набор уровней $E_{i\text{imp}}$, расположенных как выше, так и ниже μ , максимум на зависимости $\rho(T)$ полностью замывается.

Как следует из магнитной фазовой диаграммы (рис. 5), сплавы $(\text{Cr}_{1-x}\text{Mn}_x)$ —1.3 ат.% Si с $x \approx x_{\text{res}}$ имеют соизмеримую структуру, поэтому в этих сплавах должно происходить резонансное рассеяние на единичном примесном уровне $E_{i\text{imp}}^+$ и для них применимы три рассмотренных выше случая поведения $\rho_{\text{res}}(T)$ в зависимости от положения μ относительно $E_{i\text{imp}}^+$. В частности, при условии $\mu < E_{i\text{imp}0}^+$ вклад от резонансного рассеяния на примесном уровне $E_{i\text{imp}}^+$, $\rho_{\text{res}}^+(T)$ может привести к появлению низкотемпературного минимума электросопротивления. Тем не менее как в сплавах $(\text{Cr}_{1-x}\text{Mn}_x)$ —2.7 ат.% Fe ($x \leq x_{\text{res}}$) [18], так и в сплавах $(\text{Cr}_{1-x}\text{Mn}_x)$ —1.5 ат.% Fe ($x \leq x_{\text{res}}$) [17] низкотемпературных минимумов электросопротивления обнаружено не было. Эта ситуация была объяснена в [18] как следствие слабо меняющейся функции $E_{i\text{imp}}^+(T)$ из-за высоких значений T_N в этих сплавах. Тем не менее, несмотря на то что сплавы $(\text{Cr}_{1-x}\text{Mn}_x)$ —1.3 ат.% Si имеют более высокие значения T_N по сравнению со сплавами $(\text{Cr}_{1-x}\text{Mn}_x)$ —2.7 ат.% Fe, на кривых $\rho(T)$ сплавов $(\text{Cr}_{1-x}\text{Mn}_x)$ —1.3 ат.% Si с $x=0.30, 0.47$ ат.% ($x \leq x_{\text{res}}$), имеющих соизмеримую структуру, низкотемпературные минимумы обнаружены (рис. 3). Поэтому можно предположить, что природа возникновения низкотемпературных минимумов электросопротивления в сплавах Cr с $\mu \leq E_{i\text{imp}}^+$ зависит от типа примеси.

Для обсуждения поведения $\rho(T)$ сплавов с $\mu \leq E_{i\text{imp}}^+$ необходимо также рассматривать рассеяние на примесных уровнях с энергией $E_{i\text{imp}}^-$, где под $E_{i\text{imp}}^-$ следует понимать энергию единичного примесного уровня в случае сплавов с соизмеримой структурой и энергию центра сгустка примесных уровней в сплавах с несоизмеримой структурой. Как было показано выше, в случае $E_{i\text{imp}}^- < \mu < E_{i\text{imp}}^+$ вклад $\rho_{\text{res}}(T)$ может быть положительным. Если при $\mu \leq E_{i\text{imp}}^+$ величина этого вклада остается достаточно большой,

он может подавить $\rho_{\text{res}}^+(T)$ и низкотемпературный минимум электросопротивления не возникнет.

Анализ зависимостей $\rho_{4.2}(x, y)$ сплавов на основе Cr—2.7 ат. % Fe и Cr—1.3 ат. % Si (рис. 1) свидетельствует о том, что в обоих случаях рассеяние на примесных уровнях E_{imp} значительно сильнее, чем на E_{imp}^+ . Однако можно констатировать, что при отклонении μ от значения E_{imp}^+ в сторону больших энергий вклад от рассеяния на примесном уровне E_{imp} ($\rho_{\text{res}}(\mu)$) в сплавах на основе Cr—2.7 ат. % Fe остается достаточно большим даже в минимуме зависимости $\rho_{4.2}(x, y)$ (значение $\rho_{4.2}(y_{\min})$ почти в два раза превышает $\rho_{4.2 \text{ pot}}(x, y=0)$). В сплавах на основе Cr—1.3 ат. % Si вклад $\rho_{\text{res}}(\mu)$ убывает значительно быстрее и минимальное значение $\rho_{4.2}$ лишь незначительно превышает $\rho_{4.2 \text{ pot}}(x, y=0)$.

Таким образом, вклад ρ_{res} в сплавах $(\text{Cr}_{1-x}\text{Mn}_x)$ —2.7 ат. % Fe с $\mu \leq E_{\text{imp}}^+$ может сохраняться достаточно большим, что приводит к подавлению $\rho_{\text{res}}^+(T)$. В сплавах $(\text{Cr}_{1-x}\text{Mn}_x)$ —1.3 ат. % Si при $\mu \leq E_{\text{imp}}^+$ вклад $\rho_{\text{res}}(T)$ проявляется значительно слабее и наличие вклада $\rho_{\text{res}}^+(T)$ с отрицательным наклоном приводит к появлению минимума на зависимости $\rho(T)$.

Как отмечалось в [13], в сплавах $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ —2.7 ат. % Fe с концентрацией ванадия ($y > 3$ ат. %), достаточной для подавления антиферромагнетизма, наблюдаются низкотемпературные минимумы электросопротивления кондосского типа. Аналогичные минимумы наблюдаются также и в сплавах $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ —1.5 ат. % Fe ($y > 3$ ат. %) [17]. Как видно из рис. 2 (кривая 8), в парамагнитных сплавах $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ —1.3 ат. % Si таких минимумов электросопротивления не обнаружено. Этот факт подтверждает то, что в сплавах Cr—Si и Cr—Si—V не существует локализованных магнитных моментов, поэтому в них не может быть реализован кондосский механизм рассеяния.

Теперь перейдем к рассмотрению температурных зависимостей электросопротивления бинарных сплавов $\text{Cr}_{1-x}\text{Si}_x$. Известно, что в АФ сплавах Cr—Si величина химического потенциала повышается с ростом концентрации Si [18]. Поэтому повышение μ в сплаве Cr—1.3 ат. % Si можно достичь не только добавлением Mn, но и увеличением концентрации Si. Соответственно понижение μ исходного сплава происходит при легировании ванадием или при понижении концентрации Si.

Сразу же отговоримся, что эти два способа смещения химического потенциала являются неадекватными в связи со следующими обстоятельствами.

1) Приближение жесткой зоны применимо в случае легирования сплава Cr—1.3 ат. % Si марганцем и ванадием и не применимо при изменении концентрации Si.

2) При добавлении ванадия происходит снижение T_N , а при снижении концентрации Si величина T_N растет. Соответственно легирование марганцем и повышение концентрации Si также оказывают противоположное воздействие на T_N .

3) Концентрация примесных резонансных центров n_{res} в сплаве Cr—1.3 ат. % Si не изменяется при добавлении Mn и V, а при изменении концентрации Si наряду со смещением μ происходит изменение n_{res} .

Несмотря на вышеуказанные различия, сравнение температурных зависимостей электросопротивления тройных сплавов Cr—1.3 ат. % Si, легированных Mn и V (рис. 3), и бинарных сплавов Cr—Si (рис. 4 из [?]) свидетельствует о том, что для обеих серий сплавов наблюдаются низкотемпературные минимумы электросопротивления при смещении μ вверх и вниз от положения μ_0 , где μ_0 — химический потенциал сплава Cr—1.3 ат. % Si, причем в обоих случаях минимумы существуют приблизительно при одних и тех же значениях μ . Следует отметить, что в сплавах Cr—Si, так же как и в сплавах $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ —1.3 ат. % Si, не обнаружены низкотемпературные максимумы электросопротивления. По-видимому, причина их отсутствия в обоих случаях одна и та же. Однако в поведении

электросопротивления рассматриваемых бинарных и тройных сплавов имеется ряд особенностей, которые легко объяснить, принимая во внимание перечисленные выше различия, возникающие в этих сплавах при изменении положения μ . Совершенно очевидно, что в сплавах Cr—Si при выполнении условия $\mu < E_{\text{imp}}$ нельзя ожидать столь сильного вклада ρ_{res} в полное электросопротивление, как в случае сплавов $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ — 1.3 ат. % Si из-за низкой концентрации резонансных примесей и высоких значений температуры Нееля. С другой стороны, в сплавах $\text{Cr}_{1-x}\text{Si}_x$ с ростом концентрации Si концентрация резонансных примесей возрастает, а T_N уменьшается, что должно приводить к возрастанию вклада $\rho_{\text{res}}(T)$ в полное $\rho(T)$ при низких температурах. Этим обстоятельством можно объяснить аномальный рост электросопротивления с понижением температуры ниже точки Нееля в сплаве Cr—3.6 ат. % Si [7].

Зная значения y_{res} и x_{res} в тройных сплавах на основе Cr—1.3 ат. % Si, а также величину смещения μ при добавлении 1 ат. % Mn, V и Si, можно оценить значения z_{res}^- и z_{res}^+ в сплавах $\text{Cr}_{1-z}\text{Si}_z$, где $z_{\text{res}}^- \approx 0.9$ ат. % — концентрация, при которой химический потенциал сплава $\text{Cr}_{1-z}\text{Si}_z$, так же как и сплава $(\text{Cr}_{1-y}\text{V}_y)$ — 1.3 ат. % Si ($y = y_{\text{res}}$), находится в центре сгустка примесных уровней, а $z_{\text{res}}^+ \approx 2.5$ ат. % — концентрация, при которой μ , так же как и μ сплава $(\text{Cr}_{1-x}\text{Mn}_x)$ — 1.3 ат. % Si ($x = x_{\text{res}}$), удовлетворяет условию $\mu = E_{\text{imp}}^+$.

Если из зависимости $\rho_{4.2}(x, y)$ для сплавов на основе Cr—1.3 ат. % Si (рис. 1) выделить $\rho_{4.2 \text{ res}}(x, y)$, то очевидно, что между значениями x_{res} и y_{res} будет наблюдаться глубокий минимум. В случае справедливости предложенной модели для бинарных сплавов $\text{Cr}_{1-z}\text{Si}_z$ аналогичный минимум должен наблюдаваться между значениями z_{res}^- и z_{res}^+ на кривой $\rho_{4.2 \text{ res}}(z)$. Действительно, на зависимости $\rho_{4.2}(z)$ (см. рис. 6 из [7]) на фоне линейно изменяющейся функции $\rho_{4.2 \text{ pot}}(z)$ наблюдается значительный провал как раз в области концентрации Si $z_{\text{res}}^- < z < z_{\text{res}}^+$.

Таким образом, можно констатировать, что как в бинарных, так и тройных сплавах на основе Cr—Si примесное резонансное рассеяние является основным фактором, определяющим поведение $\rho(T)$ в области низких температур.

Список литературы

- [1] Куликов Н. И., Тугушев В. В. // УФН. 1984. Т. 144. № 4. С. 643—680.
- [2] Fawcett E. // Rev. Mod. Phys. 1988. V. 60. N 1. P. 209—283.
- [3] Arajs S. // Phys. Stat. Sol. 1970. V. 37. N 1. P. 329—336.
- [4] Katano S., Mori N. // J. Phys. Soc. Japan. 1979. V. 46. N 4. P. 1265—1272.
- [5] Katano S., Mori N., Nakayama N. // J. Phys. Soc. Japan. 1980. V. 48. N 1. P. 192—199.
- [6] Arajs S., Dunmyre G. R. // J. Appl. Phys. 1967. V. 38. N 3. P. 1157—1158.
- [7] Arajs S., Katzenmeyer W. E. // J. Phys. Soc. Japan. 1967. V. 23. N 5. P. 932—936.
- [8] Arajs S., Katzenmeyer W. E. // J. Phys. Chem. Solids. 1967. V. 28. N 7. P. 1459—1564.
- [9] Galkin V. // JMMM. 1989. V. 79. P. 327—332.
- [10] Галкин В. Ю., Тугушев В. В., Тугушева Т. Е. // ФТТ. 1986. Т. 28. № 8. С. 2290—2298.
- [11] Болков Б. А., Тугушев В. В. // ФТТ. 1984. Т. 26. № 8. С. 2428—2436.
- [12] Галкин В. Ю. // ФММ. 1987. Т. 64. № 6. С. 1199—1202.
- [13] Галкин В. Ю., Тугушева Т. Е. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 3. С. 845—852.
- [14] Буздин А. И., Меньшов В. Н., Тугушев В. В. // ЖЭТФ. 1986. Т. 91. С. 2204—2219.
- [15] Suzuki T. // J. Phys. Soc. Japan. 1977. V. 43. P. 869—874.
- [16] Alberts H. L., Lourens J. A. J. // J. Phys. F. 1988. V. 18. P. 123—135.
- [17] Галкин В. Ю., Тугушева Т. Е. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 9. С. 261—264.
- [18] Benediktsson G., Hedman L., Astrom H. U., Rao K. V. // J. Phys. F. 1982. V. 12. P. 1439—1452.

Центральный

научно-исследовательский институт
черной металлургии им. И. П. Бардина
Москва

Поступило в Редакцию
3 апреля 1991 г.